

**“7th International Conference on Reactive Plasmas and
63rd Gaseous Electronics Conference / 28th Symposium on
Processing Plasmas**

(略称： ICRP-7 / GEC-63 / SPP-28) 開催趣意書

- I. 国際会議の趣旨
- II. 主催団体・共催団体、協賛団体
- III. 開催時期・開催地・会場
- IV. 参加予定国・参加予定者数・スケジュール
- V. 組織体制

5-1. Organizing Committee

5-2. Advisory Committee

5-3. Steering Committee

ICRP-7 / SPP-28 組織委員長 堀 勝 (名古屋大学大学院工学研究科)

**“7th International Conference on Reactive Plasmas and
63rd Gaseous Electronics Conference / 28th Symposium on Processing
Plasmas
開催趣意書**

I.国際会議の趣旨

1-1. 会議の名称

和文名 第7回反応性プラズマ国際会議／第63回電離気体会議／
第28回プラズマプロセッシング研究会

英文名 7th International Conference on Reactive Plasmas /
63rd Gaseous Electronics Conference/28th Symposium on Processing Plasmas

略称 ICRP-7 / GEC-63 / SPP-28

1-2. 会議開催の目的

反応性プラズマを利用したプラズマプロセスは、薄膜電子デバイスの製造、半導体集積回路の超微細加工、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー等に関わる新素材の創製、環境科学等における基盤技術として発展しています。本国際会議は、プラズマプロセスに関連する諸現象を物理・化学的観点から基礎的に解明し、複雑な反応性プラズマを制御する手法を学術的に確立することを主眼とすると共に、これを基にした最先端のプラズマ応用について、国内外の第一線の研究者による講演、研究発表、討議を行います。これにより、この分野の一層の発展を期するとともに、プラズマプロセスに係わる研究者の国際的な連携を強めます。

1-3. 会議開催の経緯

応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会（1989年度以前はプラズマエレクトロニクス研究会）では、年1回「プラズマプロセッシング研究会（Symposium on Plasma Processing）」を開催しており、2010年2月の研究会で第27回を迎えます。この間、この分野の研究の活発化は世界的に著しく、また、日本の研究レベルも世界の最高水準にあるといえます。「プラズマプロセッシング研究会」はこのような高水準の研究発表がなされる、国内研究者の重要な発表の場となっております。このような状況下で、プラズマプロセスに係わる研究者の国際的な連携を強化し、この分野の研究の進展を一層強化するため、プラズマエレクトロニクス分科会ではプラズマプロセッシング研究会を3年程度に1回、国際会議として開催することとし、これまでに1991年に名古屋で、1994年に横浜で、1997年に奈良で、1998年にハワイで（アメリカ物理学会の会議であるGECと合同会議）、2002年にはフランスで（ESCAMPIGと合同会議）、2006年に宮城県松島町で、計6回の国際会議を成功裏に開催してきております。今回はGECとの合同開催の2回目として、欧州のグループとも連携をとり、パリでの開催に向けて準備を進めてきております。

1-4. 会議主要題目（以下全て仮題）

一般セッション

- (i) 反応性プラズマの発生・制御
- (ii) 反応性プラズマの診断・計測
- (iii) 反応性プラズマ内の輸送現象と原子・分子素過程
- (iv) モデリングとシミュレーション
- (v) パーティクル・ダストの発生と挙動
- (vi) プラズマ-固体相互作用と表面改質等への応用
- (vii) エッチング
- (viii) デポジション
- (ix) マイクロ，大気圧プラズマの応用
- (x) ナノテクノロジー，バイオテクノロジーへの応用
- (xi) 反応性プラズマの新展開

1-5. 会議論文集等

会議の Proceedings を発行します（会議当日，参加者に配布）．また，発表論文の一部を Japanese Journal of Applied Physics (JJAP) の特集号“Plasma Processing”として 2011 年に刊行する予定です．

II.主催団体・共催団体、協賛団体

共催：アメリカ物理学会 (American Physical Society)

応用物理学会 (The Japan Society of Applied Physics)

協賛： (予定)

化学工学会

照明学会

電気学会

日本化学会

日本真空協会

日本表面科学会

表面技術協会

放電学会

原子衝突研究協会

静電気学会

電子情報通信学会

日本金属学会

日本セラミックス学会

日本物理学会

フラーレン・ナノ

チューブ学会

溶接学会

高分子学会

電気化学会

日本オゾン協会

日本航空宇宙学会

日本鉄鋼協会

バイオメカニズム学会

プラズマ・核融合学会

レーザー学会

V. 組織体制

Organizing Committee

M. Hori (Chair)	Nagoya University
M. Shiratani (Vice-Chair)	Kyushu University
J.G. Han (Vice-Chair)	Sungkyunkwan University
H. Toyoda (Secretary)	Nagoya University

(Domestic member)

K. Eriguchi	Kyoto University
S. Hamaguchi	Kyoto University
M. Hiramatsu	Meijo University
M. Izawa	Hitachi
T. Kaneko	Tohoku University
K. Kinoshita	NEC
M. Kondo	National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
M. Nagatsu	Shizuoka University
K. Nakamura	Mitsubishi Electric
T. Nozaki	Tokyo Institute of Technology
T. Ohiwa	Toshiba Corporation.
M. Sasaki	Toyota Technological Institute
I. Sawada	Tokyo Electron
Y. Setsuhara	Osaka University
T. Tatumi	Sony Corporation
K. Terashima	The University of Tokyo

(Overseas Member)

M. Bowden	Open University
E. Choi	Kwangwoon University
U. Czarnetzki	Ruhr University Bochum
P. Favia	University of Bari
U. Kortshagen	University of Minnesota
R. Liang	Fudan University
K. Ostrikov	CSIRO
R. van de Sanden	Eindhoven University of Technology

Advisory Committee

(Domestic Member)

R. Hatakeyama	Tohoku University
A. Kono	Nagoya University
K. Ono	Kyoto University

(Overseas Member)

R. Boswell	Australian National University
R. d'Agostino	University of Bari
N. Sadeghi	Grenoble University
J. Winter	Ruhr University Bochum

Steering Committee

T. Ishijima	Nagoya University
T. Ito	Osaka University
M. Kambara	The University of Tokyo
F. Mitsugi	Kumamoto University
A. Sampei	Kyoto Institute of Technology
